

Énoncé sur les dépôts des couches minces par voie sèche (PVD)

Nous voulons déposer des couches minces en nitrures de titane (TiN) par la méthode de pulvérisation cathodique magnétron sur un acier fortement allié au Ti-Mo-Cr.

Données : Gaz utilisé Argon, Pression= 10^{-7} mbar

1. Montrer le schéma de la technique utilisée
 2. Les techniques de préparation du substrat
 3. Citez tous les paramètres de dépôt
 4. Décrire le mécanisme de dépôt
-